PAT-NO:

JP406130224A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 06130224 A

TITLE:

POLARIZING BEAM SPLITTER

PUBN-DATE:

May 13, 1994

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

HAMADA, TOSHIMASA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHARP CORP

N/A

APPL-NO:

JP04277420

APPL-DATE:

October 15, 1992

INT-CL (IPC): G02B005/30

US-CL-CURRENT: 359/495

#### **ABSTRACT:**

PURPOSE: To attain the light weight and miniaturization of the whole optical

system by arranging optical multilayer film protruded on a transparent

substrate and a material having, specific refractive index between the optical

multilayer films, and comprising the optical multilayer film by applying

specific film repeatedly.

CONSTITUTION: Assuming an equivalent refractive index for first polarized

light as M1 and that for second polarized light as M2 when an incident

direction is decided, a diffraction grating in which the optical multilayer

film 2 is stacked partially and the material 3 with refractive index N2 is

arranged in an area where no optical multilayer film 2 is stacked is generated.

When light is made incident on such diffraction grating, it functions as the

diffraction grating of refractive index change type of refractive index N1 and

refractive index N2 for the first polarized light, and light is emitted as

diffracted light 5. As for the second polarized light, a function as the

diffraction grating is not provided since the refractive index of the optical

multilayer film 2 coincides with that of the arranged material 3, and light is

transmitted as it is as non-diffracted light 6. Therefore, it is possible to

comprise a polarizing beam splitter of plate shape by forming such diffraction

grating on a thin substrate 1.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO&Japio

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-130224

(43)公開日 平成6年(1994)5月13日

(51)Int.CL<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 5/30

9018-2K

審査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平4-277420

(22)出願日

平成4年(1992)10月15日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 浜田 敏正

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

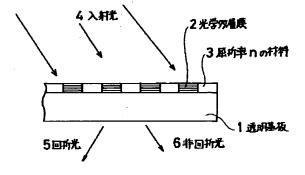
(74)代理人 弁理士 野河 信太郎

#### (54)【発明の名称】 偏光ピームスプリッタ

#### (57)【要約】

【目的】 光学系の小型化、軽量化を図る。

【構成】 透明基板上に突設された光学多層膜と該光学 多層膜間に屈折率nをもつ材料が配設されてなり、前記 光学多層膜が対称な膜の繰り返しで構成され、かつ屈折 率nが、第1の偏光に対する等価屈折率あるいは第2の **偏光に対する等価屈折率と等しい材料からなることを特** 徴とする偏光ビームスプリッタ。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板上に突設された光学多層膜と該 光学多層膜間に屈折率nをもつ材料が配設されてなり、 前記光学多層膜が対称な膜の繰り返しで構成され、かつ 屈折率 nが、第1の偏光に対する等価屈折率あるいは第 2の偏光に対する等価屈折率と等しい材料からなること を特徴とする偏光ビームスプリッタ。

【請求項2】 光学多層膜が少なくとも3層の積層層か らなり、該積層層のうち1層目と3層目の屈折率と層厚 がそれぞれ等しい請求項1記載の偏光ビームスプリッ 9.

【請求項3】 光学多層膜全体が屈折率 n をもつ材料で 被着されてなる請求項1又は2記載の偏光ビームスプリ ッタ。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、偏光ビームスプリッタ に関する。さらに詳しくは、光磁気ディスク等の光学式 情報読み取り装置、光学式情報書き込み装置に使用され る偏光ビームスプリッタに関する。

[0002]

【従来の技術と発明が解決しようとする課題】従来の偏 光子として(i)ニコルプリズムのように結晶の複屈折 を利用した複屈折型偏光子、(ii)ポーラロイドのように 高分子の光2色性を利用した2色性偏光子、(iii) 偏光 角の性質を利用し、S偏光(入射面に垂直な振動面をも つ偏光成分) の反射光を使う反射型偏光子と積層型偏光 子と呼ばれる透過型偏光子がある。薄膜を利用した薄膜 偏光子はプリズム型と平板型に分けられ、上記(iii) の ように偏光角を利用したもの、斜入射の場合のS偏光と 30 P偏光(入射面に平行な振動面をもつ偏光成分)の不透 過帯の違いを利用したものがある。 このような偏光子は 他の偏光子に比べ安価であり、反射光と透過光共に優れ た偏光度が得られ、主にビームスプリッタとして使用さ れている。

【0003】図5に従来使用されている偏光ビームスプ. リッタの一例を示す。この偏光ビームスプリッタはマク ナイル型と呼ばれるタイプで、異なった2つの屈折率の 層を積層した薄膜層14を、プリズム15で挟み込んだ 構造になっている。この構造をもちいて偏光分離するた 40 めには、以下の式(1)を満たす必要がある。

 $\sin^2 \theta_G = n_H^2 n_L^2 / n_G^2 (n_H^2 + n_L^2)$ (1)

(ここで、 $\theta$ 6は入射角、n  $\pi$  は2つの層のうち高いほ うの屈折率、п. は2つの層のうのうち低いほうの屈折 率及びngはプリズム材料の屈折率を示す。) このような マクナイル型偏光ビームスプリッタにおいて、例えば、  $\theta_G=45^\circ$ 、 $n_H=2.1$ 、 $n_L=1.38$ とすると、上 記式(1)よりng=1.63が得られ、この屈折率を持 つ材料でプリズムを形成する必要がある。

【0004】上記のような、偏光ビームスプリッタで

は、使用する材料の屈折率に制限があり、プリズムを使 うことからも低価格化は非常に困難である。また、光学 系の小型化、軽量化を図る場合にも、プリズムのサイズ と重量のために制限を受けてしまう。

[0005]

【課題を解決するための手段及び作用】かくして本発明 によれば、透明基板上に突設された光学多層膜と該光学 多層膜間に屈折率nをもつ材料が配設されてなり、前記 光学多層膜が対称な膜の繰り返しで構成され、かつ屈折 10 率nが、第1の偏光に対する等価屈折率あるいは第2の **偏光に対する等価屈折率と等しい材料からなることを特** 徴とする偏光ビームスプリッタが提供される。

【0006】図1に本発明の偏光ビームスプリッタの例 を示す。このような対称な膜の繰り返しで構成される光 学多層膜2は、光の波長、入射角及び偏光方向を固定す ると、等価的に一つの屈折率の層に置き換えることがで きる。このことは言い換えると、入射光4が斜めから入 射される場合、偏光方向によって屈折率が異なることを 意味する。

【0007】入射方向を決めたとき、第1の偏光に対す 20 る等価屈折率をN1、第2の偏光に対する等価屈折率を N2とする。光学多層膜2を部分的に積層し、光学多層 膜2を積層していない領域に屈折率N2の材料3を配設 した回折格子を作製する。この回折格子に光が入射する と、第1の偏光に対しては屈折率N1とN2の屈折率変 化型の回折格子として働き、回折光5として射出され、 第2の偏光に関しては、光学多層膜2の屈折率と配設材 料3の屈折率とが一致するため、回折格子としての働き はせず、非回折光6としてそのまま透過する。従って、 この回折格子を薄い基板上に形成すれば、図1のような 平板型の偏光ビームスプリッタを構成することが可能に なる。

【0008】本発明に使用できる透明基板としては、ガ ラス、プラスチック等通常用いられる基板が使用でき る。光学多層膜の構成としては、回折効率が最大となる ように光学多層膜を構成することが好ましく、S偏光に 対する等価屈折率をNs、P偏光に対する等価屈折率を Npとすると、その膜厚が

 $d = \lambda \cos \theta / |Ns - Np|$ 

となるように膜厚dを設定することが好ましい。

【0009】さらに光学多層膜の構成は、1層目と3層 目の層厚と屈折率がそれぞれ等しい3層膜を基本構造と し、この基本構造をさらに積層することが好ましい。こ のような層を構成する材料としては、屈折率1.4~ 2. 5の材料が好ましく、例えばSiO2, TiO2, ZnS, MgF2 等が挙げられる。光学多層膜の積層方 法としては、電子ビーム蒸着法、スパッタ法等によって 積層された膜をリアクティブイオンエッチング、イオン ミリング等のドライエッチング法により微細な回折格子

50 パターンを形成する方法が使用できる。

3

【0010】さらに、突設された上記光学多層膜間に配設される、屈折率nを持つ材料としては、エポキシ系樹脂等があげられる。この材料は突設された光学多層膜間のみに配設されてもよく、図2に示すように光学多層膜全体を覆うように形成することもできる。光学多層膜を覆うように形成する場合、その膜厚は100μm以上が好ましい。

【0011】ここで対称な3層膜を基本構造とする光学 多層膜を用いた場合の、偏光の原理を説明する。図3の ような屈折率 ng の層と、屈折率 ng の層からなる3層膜に、波長入の光が角度  $\theta$ で入射したときを考える(対称構造なので、1層目と3層目の屈折率は等しい。)。このような対称な構造をもつ光学多層膜は、光の波長、入射角及び偏光方向を固定すると、等価的に一つの屈折率の層に置き換えることができる。等価屈折率は以下に示す(2)式、(3)式から計算できる。

[0012]

【数1】

5

6

ල

S値光に対する特価同析学をN

n n n ccos p r cus p esin2grcosgo+ (n r cos p r cos go-n o cos p esin go) singo n n n o cos o n cos o o sin 2 gr cos got (n o cos o o cos gr n o cos o o sin go singo = n acos 4 a

P価光に対する等価配出来をNp

11 x N 0005" | \$ x cos" | \$ 0 sin2grcosgo + ( 11 x cos" \$ \$ x cos go - 11 o cos" \$ 6 osin go) singo nanocos" pacos" posin2gacosgo+(no cos" pocos"gun cos" pocos"gun cos φ \* n n

(IIL, gr=27 madacos pa/ A

do:風折率n。の層の順厚 1: 光の波段

dk:配打等ngの脳の順列

go = 2π n adocos φo/λ

 $\cos \phi_R = \sqrt{1-\sin^2/\ln R}$ 

cos φ • - 1-sin²/ n •

従って、入射方向を決めたとき、一つの偏光に対する等 価屈折率N1と他方の偏光に対する等価屈折率N2とは 異なった値をとることになる。光学多層膜を部分的に突 設し、光学多層膜を突設していない領域に屈折率N2の 材料を配設したレリーフ型回折格子を作製する。このよ うな回折格子に光を入射すると、上記でも説明したよう に、一方の偏光に対しては屈折率N1とN2の屈折率変 化型の回折格子として働くが、他方の偏光に対しては、\*50

\* 光学多層膜の屈折率と充填材料の屈折率が一致するため 回折格子としての働きはせず、光はそのまま透過する。 従って、3層型の光学多層膜を用いた場合でも平板型の ビームスプリッタを構成することができる。

## [0013]

【実施例】以下に本発明の偏光ビームスプリッタの具体 例を示すが、これに限定されるものではない。 図4に示 すように、ガラス基板1上に、電子ビーム蒸着法によっ

7

て1層目に膜厚入/4のSiO27(屈折率1.4

- 6)、2層目に膜厚λ/2のTiO28(屈折率2.
- 3) 及び3層目に膜厚λ/4のSiO2 9 (屈折率1.

46)を積層し、個々の光学多層膜の間隔が10μmとなるように、リアクティブイオンエッチング法によって光学多層膜2を形成した。この光学多層膜のS偏光に対する等価屈折率をNs、P偏光に対する等価屈折率をNpは、入射角を30°とすると、それぞれNs=1.52、Np=1.74となる。

【0014】次に、上記光学多層膜間に屈折率nの材料 10 3を形成する。この材料3の屈折率nは、Nsあるいは Npのいずれかに等しい材料を選ぶ必要があり、本実施 例の場合屈折率n=1.52のエポキシ系樹脂を光学多 層膜2間に配設した。さらに本実施例において、回折効 率が最大となるのは、膜厚dが

 $d = \lambda \cos \theta / |Ns - Np|$ 

となるときであるので、上記の数値を用いて計算すると、約4人となる。従って、上記光学多層膜の3層構成を4個積層した構造が、回折効率が大きくなり最も好ましい。また3層構造を積層しても等価的な屈折率は同じ 20なので、3層構造の条件がそのまま当てはまる。

### [0015]

【発明の効果】本発明の方法によれば、一方の偏光に対しては屈折率変化型の回折格子として働くが、他方の偏光に対しては、光学多層膜の屈折率と充填材料の屈折率が一致するため回折格子としての働きはせず、光はそのまま透過する。従って、平板型偏光ビームスブリッタと

しての機能を持ち、さらに、アリズムを用いず平板上に 形成できるので、薄型で軽量化を図ることができ、光学 系全体の軽量化、小型化が可能になる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の偏光ビームスプリッタの概略断面図である.

【図2】本発明の偏光ビームスプリッタの概略断面図である。

【図3】3層構造からなる光学多層膜の拡大断面図である。

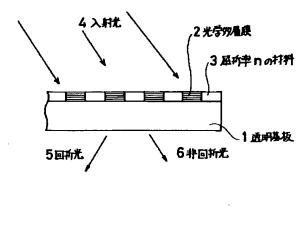
【図4】実施例に示した本発明の偏光ビームスプリッタ の概略断面図である。

【図5】従来の偏光ビームスプリッタの機略断面図である。

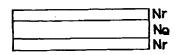
#### 【符号の説明】

- 1 透明基板
- 2 光学多層膜
- 3 屈折率 nの材料
- 4 入射光
- 20 5 回折光
  - 6 非回折光
  - 7 SiO2 膜
  - 8 TiO2 膜
  - 9 SiO2 膜
  - 14 薄膜層
  - 15 プリズム

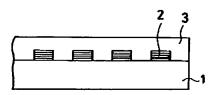
【図1】



【図3】



【図2】



【図5】

